

(Translation)

Office Action from Korean Patent Office

Dated mailed :
May 27, 2003

Applicants : CANON SALES CO., INC. et al.
(Applicant Code: 520000119997)
11-28, Mita 3-chome, Minato-ku, Tokyo 108-0073, Japan

Attorney : Doo-Hyun Moon et al.
Haesung Bldg, 11F, 942, Daechi-dong, Kangnam-ku,
Seoul, Korea

Patent Application No.:
10-2001-0016176

Title of Invention :
FILM-FORMING SURFACE REFORMING METHOD AND
SEMICONDUCTOR DEVICE MANUFACTURING METHOD

The term for reply is 2 months.

Rejections- Korea Codes 29-2
All claims are obvious.

Cited references

- (1) Korean Patent Publication 1995-7032
- (2) Japanese Kokai Hei 11-111714

출력 일자: 2003/5/28

발송번호 : 9-5-2003-019307526

수신 : 서울 강남구 대치3동 942 해성빌딩 11층

발송일자 : 2003.05.27

문두현 귀하

제출기일 : 2003.07.27

135-725

특허청 의견제출통지서

출원인 명칭 캐논 한바이 가부시끼가이샤 외 1 명 (출원인코드: 520000119997)
주소 일본국 도쿄도 미나토구 미타 3-11-28
대리인 성명 문두현 외 1 명
주소 서울 강남구 대치3동 942 해성빌딩 11층
출원번호 10-2001-0016176
발명의 명칭 피성막면의 개질 방법 및 반도체 장치의 제조 방법

이 출원에 대한 심사결과 아래와 같은 거절이유가 있어 특허법 제63조의 규정에 의하여 이를 통지하오니 의견이 있거나 보정이 필요할 경우에는 상기 제출기일까지 의견서[특허법시행규칙 별지 제25호서식의2서식] 또는/및 보정서[특허법시행규칙 별지 제5호서식]를 제출하여 주시기 바랍니다. (상기 제출기일에 대하여 매회 1월 단위로 연장을 신청할 수 있으며, 이 신청에 대하여 별도의 기간연장승인통지되는 하지 않습니다.)

[이유]

이 출원의 특허청구범위 전항에 기재된 발명은 그 출원전에 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 아래에 지적한 것에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 것으로 특허법 제29조제2항의 규정에 의하여 특허를 받을 수 없습니다.

1. 본원 발명은 기관의 피성막면에 절연막을 성막하기 전에 암모니아, 아민 등의 가스 또는 수용액을 을 접촉시킨 후 절연막을 성막하여 피성막면의 하지의존성을 개선시키는 방법에 관한 것이나,

인용발명1(한국공개특허공보 1995-7032호)에는 하부절연층 표면을 질소, 산화질소, 산소, 또는 오존 등으로 처리한 후 절연물질을 증착하는 기술이 기재되어 있고, 인용발명2(일본공개특허공보 평 11-111714호)도 아민 등을 포함하는 가스로 처리한 후 막을 성장시키는 장치에 관한 것이므로

본원 발명은 본원 발명의 기술분야에 속하는 통상의 지식을 가진 자가 인용발명1 및 2로부터 용이하게 발명할 수 있는 것입니다.

[참 부]

첨부 1 한국공개특허공보 1995-7032호(1995.03.21) 1부

첨부 2 일본공개특허공보 평11-111714호(1999.04.23) 1부 끝.

2003.05.27

특허청

심사4국

반도체1심사담당관실

심사관 이선택



출력 일자: 2003/5/28

<<안내>>

문의사항이 있으시면 ☎ 042-481-5980 로 문의하시기 바랍니다.

특허청 직원 모두는 깨끗한 특허행정의 구현을 위하여 최선을 다하고 있습니다. 만일 업무처리과정에서 직원의 부조리행위가 있으면 신고하여 주시기 바랍니다.

▶ 홈페이지(www.kipo.go.kr)내 부조리신고센터